

金刚石薄膜 MPCVD 关键技术

工艺参数系统研究与产业化路径

本页为试读样章。

完整版含更多章节与案例。

本研究拟解决的问题

工艺参数的
系统研究

形核密度与氢等离子体处理

均匀沉积

可控性生长

氮气的引入

MPCVD关键技术的研发 加工、稳定、集成度 → 工业化